

晶片清洗 宿迁清洗 晶森半导体 清洗机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 晶片清洗 宿迁清洗 晶森半导体 清洗机 |
| 公司名称 | 苏州晶森半导体设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州工业园区金海路34号 |
| 联系电话 | 13771786452 13771786452 |

产品详情

公共事业、电力、煤气、新闻通讯行业：

需要清洗的产品：各类计量仪表、功率计、各类照明灯具、隔电瓷瓶、通讯设备关键零部件等

污染源：油墨、油、灰尘、线头、锈、泥、海盐

使用清洗剂：有机洗涤剂；轻油（石油系洗涤剂）；碱性洗涤剂、中性洗涤剂

按频率波可以分为三种，即次声波、声波、超声波。次声波的频率为20Hz以下；声波的频率为20Hz~20k Hz；超声波的频率则为20kHz以上。其中的次声波和超声波一般人耳是听不到的。超声波由于频率高、波长短，因而传播的方向性好、穿透能力强，这也就是设计制作超声波清洗机的原因。

半导体清洗

半导体清洗机在清洁过程中使用普通自来水、酒精、溶剂来进行清洗就可以了。没有那么多各种各样的清洗剂。

半导体清洗机大功率换能器清洗效果良好，可用肉眼观察到，清洗后物体闪亮发光。而且他是机械定时控制开机时间。全不锈钢外壳与盖子、内胆，更显*档。新版本的半导体清洗机在防水性方面大大改进，湿法清洗设备，产品更加安全持久，配了排水球阀，带加热配恒温系统，配不锈钢清洗篮可按照客户的要求设计制造。

等离子清洗法利用等离子体产生的自由基与有机异物反应，晶片清洗，再以气流的方式去除，从而达到清洗的目的。由于AP功率强，一般会对金属表面产生影响，所以，宿迁清洗，在金属制程中一般不采用

AP Plasma的清洗技术。AP使用的气体主要是氮气和空气按照一定的比例混合，晶圆清洗设备，同时，和玻璃基板保持合适的距离，加载一定的电压，从而产生自由基，对基板表面进行清洁。